

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成17年11月17日(2005.11.17)

【公開番号】特開2005-243988(P2005-243988A)
 【公開日】平成17年9月8日(2005.9.8)
 【年通号数】公開・登録公報2005-035
 【出願番号】特願2004-52808(P2004-52808)
 【国際特許分類第7版】
 H 0 1 L 21/3065
 【F I】
 H 0 1 L 21/302 1 0 1 H

【手続補正書】
 【提出日】平成17年9月30日(2005.9.30)
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項1】

その内部にプラズマが形成される処理室と、該処理室の内側の下部に配置されその上に基板状の試料が載置される試料台と、該試料台に高周波電力を印加する電源と、前記試料台における前記試料が載置される面の外周側に配置されて前記試料台を覆うカバーとを有し、前記処理室内の前記試料台の上方の空間に生成したプラズマを用いて前記試料を処理するプラズマ処理装置であって、

前記カバーが、前記試料の外周端の下方に位置し、かつ、前記プラズマに面する箇所の表面を被覆する Y_2O_3 、 Yb_2O_3 又は YF_3 を主成分とした材料あるいはこれらの混合材から構成された被膜を備えたことを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項2】

その内部にプラズマが形成される処理室と、該処理室の内側の下部に配置されその上に基板状の試料が載置される試料台と、該試料台に高周波電力を印加する電源と、前記試料台における前記試料が載置される面の外周側に配置されて前記試料台を覆うカバーとを有し、前記処理室内の前記試料台の上方の空間に生成したプラズマを用いて前記試料を処理するプラズマ処理装置であって、

前記カバーが、前記試料の外周端の直下方の部分と該部分の外周側で前記外周端の外周側に位置してその断面がテーパ状の部分、又は、前記試料の外周端の直下方の部分及び前記テーパ状の部分の少なくとも一部を被覆する Y_2O_3 、 Yb_2O_3 又は YF_3 を主成分とした材料あるいはこれらの混合材から構成された被膜であって、前記試料の外周端の直下方の部分が他の部分より厚くされた被膜を備えたことを特徴とするプラズマ処理装置。

【手続補正2】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0012
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0012】

本発明は、その内部にプラズマが形成される処理室と、該処理室の内側の下部に配置されその上に基板状の試料が載置される試料台と、該試料台に高周波電力を印加する電源と

、前記試料台における前記試料が載置される面の外周側に配置されて前記試料台を覆うカバーとを有し、前記処理室内の前記試料台の上方の空間に生成したプラズマを用いて前記試料を処理するプラズマ処理装置であって、前記カバーが、前記試料の外周端の下方に位置し、かつ、前記プラズマに面する箇所を被覆する Y_2O_3 、 Yb_2O_3 又は YF_3 を主成分とした材料あるいはこれらの混合材から構成された被膜を備えたプラズマ処理装置である。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

また、本発明は、その内部にプラズマが形成される処理室と、該処理室の内側の下部に配置されその上に基板状の試料が載置される試料台と、該試料台に高周波電力を印加する電源と、前記試料台における前記試料が載置される面の外周側に配置されて前記試料台を覆うカバーとを有し、前記処理室内の前記試料台の上方の空間に生成したプラズマを用いて前記試料を処理するプラズマ処理装置であって、前記カバーが、前記試料の外周端の直下方の部分と該部分の外周側で前記外周端の外周側に位置してその断面がテーパ状の部分、又は、前記試料の外周端の直下方の部分及び前記テーパ状の部分の少なくとも一部を被覆する Y_2O_3 、 Yb_2O_3 又は YF_3 を主成分とした材料あるいはこれらの混合材から構成された被膜であって、前記試料の外周端の直下方の部分が他の部分より厚くされた被膜を備えたプラズマ処理装置である。